

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-536291(P2004-536291A)

【公表日】平成16年12月2日(2004.12.2)

【年通号数】公開・登録公報2004-047

【出願番号】特願2002-583938(P2002-583938)

【国際特許分類第7版】

G 01 N 1/18

B 01 J 19/00

G 01 N 1/10

// C 12 M 1/00

C 12 N 15/09

C 12 Q 1/68

G 01 N 1/00

G 01 N 37/00

【F I】

G 01 N 1/18

B 01 J 19/00 3 2 1

G 01 N 1/10 H

C 12 N 15/00 A

C 12 M 1/00 A

C 12 Q 1/68 A

G 01 N 1/00 1 0 1 L

G 01 N 37/00 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成17年3月10日(2005.3.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

1対の対向主面および中心、第1の部分、ならびに第2の部分を含む矩形本体と、各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室とを含む、前記本体の第1の部分内に配置された、複数の第1の処理アレイと、

各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室とを含む、前記本体の第2の部分内に配置された、複数の第2の処理アレイと、を含むサンプル処理装置であって、

前記第1の部分および前記第2の部分が、前記中心の両側に配置され、

前記複数の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列され、

前記複数の第2の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列されている、サンプル処理装置。

【請求項2】

前記第1の処理アレイおよび前記第2の処理アレイの一次処理室によって形成された前記円弧が、中心が前記本体の中心に配置された一次処理室円を定める、請求項1に記載の装置。

**【請求項 3】**

前記複数の第1の処理アレイの入力室、および前記複数の第2の処理アレイの入力室が、直線格子アレイに配列されている、請求項1に記載の装置。

**【請求項 4】**

前記複数の処理アレイの少なくとも1つの出力室が直線格子アレイに配列されている、請求項1に記載の装置。

**【請求項 5】**

少なくとも2つの前記第1の処理アレイの入力室が、共通入力室を含む、請求項1に記載の装置。

**【請求項 6】**

各々の前記第1の処理アレイの前記一次処理室と前記出力室との間に配置された二次処理室と、

各々の前記第2の処理アレイの前記一次処理室と前記出力室との間に配置された二次処理室とをさらに含み、

前記第1の処理アレイの二次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列され、

前記第2の処理アレイの二次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列されている、請求項1に記載の装置。

**【請求項 7】**

サンプル処理装置を使用する方法であって、

サンプル処理装置を提供するステップであって、前記サンプル処理装置が、1対の対向正面および中心、第1の部分、ならびに第2の部分を含む矩形本体を含み、前記第1の部分および前記第2の部分が、前記中心の両側に配置され、前記サンプル処理装置が、前記本体の第1の部分内に配置された、複数の第1の処理アレイを含み、前記第1の処理アレイの各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室とを含み、前記複数の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列され、前記サンプル処理装置が、前記本体の第2の部分内に配置された、複数の第2の処理アレイを含み、前記第2の処理アレイの各々が、入力室と、出力室と、前記入力室と前記出力室との間に配置された一次処理室とを含み、前記複数の第2の処理アレイの一次処理室が、前記本体の中心の周りに円弧に配列されるステップと、

少なくとも一部の前記第1および第2の処理アレイの入力室内にサンプル材料をロードするステップと、

前記サンプル処理装置を、前記本体の中心を通じて延在する回転軸の周りに回転させることによって、前記入力室から、少なくとも一部の前記一次処理室に、前記サンプル材料を搬送するステップであって、前記一次処理室が、前記入力室より前記回転軸から遠くに配置されているステップとを含む、方法。

**【請求項 8】**

前記サンプル処理装置を回転させながら、電磁エネルギーを前記一次処理室内に供給するステップをさらに含む、請求項7に記載の方法。